

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 5 月 19 日 (19.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/044761 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C07C 2/22, (74) 代理人: 榎本 雅之, 外(ENOMOTO, Masayuki et al.);  
2/30, 11/107, B01J 31/36, C07B 61/00 千5418550 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号  
住友化学知的財産センター株式会社内 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016623
- (22) 国際出願日: 2004 年 11 月 2 日 (02.11.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2003-375297 2003 年 11 月 5 日 (05.11.2003) JP  
特願2003-375296 2003 年 11 月 5 日 (05.11.2003) JP  
特願2004-067147 2004 年 3 月 10 日 (10.03.2004) JP  
特願2004-067146 2004 年 3 月 10 日 (10.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友化学株式会社 (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 千1048260 東京都中央区新川二丁目27番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岩倉 和憲 (IWAKURA, Kazunori) [JP/JP]; 千5600026 大阪府豊中市玉井町4-2-8-1006 Osaka (JP). 柳川 正生 (YANAGAWA, Masao) [JP/JP]; 千6730003 兵庫県明石市鳥羽1236-2-602 Hyogo (JP). 小田 精二 (ODA, Seiji) [JP/JP]; 千5670841 大阪府茨木市桑田町2-1-244 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING 1-HEXENE

(54) 発明の名称: 1-ヘキセンの製造方法

(57) Abstract: A process for producing 1-hexene, characterized by trimerizing ethylene in the presence of a catalyst comprising a tantalum compound and a metal-containing alkylating agent under such conditions that the amount of water present in the reaction system is up to 4 times by mole the amount of tantalum atoms and/or the amount of molecular oxygen present in the reaction system is up to 2 times by mole the amount of tantalum atoms.

(57) 要約: タンタル化合物と金属を含有するアルキル化剤とを含む触媒の存在下に、反応系内の水分量がタンタル原子の4モル倍以下および/または反応系内の分子状酸素量がタンタル原子の2モル倍以下である条件下でエチレンを三量化することを特徴とする1-ヘキセンの製造方法を提供する。

WO 2005/044761 A1